# Диэлектрическая релаксация в кристаллах ТГС, легированных ортофосфорной и фосфористой кислотами

© В.К. Ярмаркин, С.Г. Шульман, Г.А. Панкова\*, Н.В. Зайцева, В.В. Леманов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия \* Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, 199034 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lemanov@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 25 сентября 2007 г.)

Исследованы процессы переключения поляризации и температурные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости кристаллов триглицинсульфата, легированных ортофосфорной и фосфористой кислотами, в диапазоне частот 100 Hz - 1 MHz и температур 140 - 340 K. Установлено, что при относительно небольшой растворимости примесей (не более 1 mol.%) легирование кристаллов сопровождается существенным изменением параметров петли диэлектрического гистерезиса, а также величины и характера температурной зависимости диэлектрических потерь, свидетельствующих об увеличении в сегнетоэлектрической фазе легированных кристаллов энергий активации и времен релаксации доменных стенок в результате их взаимодействия с примесями.

Работа выполнялась при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 05-02-16012), Программы поддержки ведущих научных школ (грант НШ-5169.2006.2) и Программы ОФН РАН.

PACS: 77.22.Gm, 77.84.Fa

## 1. Введение

Известно [1], что сегнетоэлектрические свойства кристаллов триглицинсульфата (TGS  $(NH_2CH_2COOH)_3 \cdot H_2SO_4)$ могут быть изменены в широких пределах в результате их легирования различными примесями. Так, значительное улучшение пироэлектрических показателей качества кристаллов TGS было достигнуто в ряде работ [2-8] в результате введения в их состав относительно небольших 1 mol.%количеств примесей L-аланина (около (NH<sub>2</sub>CHCH<sub>3</sub>COOH) и ортофосфорной кислоты H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. При этом, как было показано в [5-8], частичное замещение молекул H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> на H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> в составе кристаллов TGS при максимальной растворимости примеси  $\sim 3\cdot 10^{-3}$ приводит к значительному увеличению коэрцитивного поля, уменьшению диэлектрической проницаемости в максимуме и относительно небольшому (около 1°C) снижению температуры сегнетоэлектрического фазового перехода в этих кристаллах. Представлялось интересным получить дополнительную информацию о влиянии примеси Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> на физические свойства и динамику доменной структуры в кристаллах TGS и сопоставить полученные данные с влиянием примеси фосфористой кислоты H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>, существенно отличающейся от H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> как по величине дипольного момента молекул (1.79 D в  $H_3PO_3$  и 3.46 D в  $H_3PO_4$ ) [9], так и по величине среднего расстояния P-O в этих соединениях (1.47 Å в H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>) и 1.53 Å в H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) [10]. Кроме того, как известно, Н<sub>3</sub>РО<sub>3</sub> образует с молекулами глицина химическое соединение глицинфосфит NH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COOH · H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> (GPI), являющееся сегнетоэлектриком с температурой

Кюри 224 К [11] и относящееся (как и кристаллы TGS) к моноклинной сингонии [12], в то время как близкое по структуре соединение H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> с глицином — глицинфосфат NH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COOH · H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (GP) [13] — не проявляет в исследованном интервале температур ни сегнетоэлектрических, ни пьезоэлектрических свойств [14].

#### 2. Методика эксперимента

Исследуемые монокристаллы выращивались из насыщенных водных растворов TGS с примесями  $H_3PO_4$  и  $H_3PO_3$  по схеме (в случае  $H_3PO_4$ )

$$3NH_2CH_2COOH + (1 - x)H_2SO_4 + xH_3PO_4$$
$$\rightarrow (NH_2CH_2COOH)_3 \cdot (H_2SO_4)_{1-x}(H_3PO_4)_x \quad (1)$$

в диапазоне значений x в исходном растворе от 0.1 до 0.5 при медленном охлаждении растворов от 25 до 8°C со скоростью 1 градус в сутки. Полученные кристаллы имели объем до 1 сm<sup>3</sup>. Концентрация примесей в твердой фазе не превышала 1 mol.%.

Образцы для исследования диэлектрических свойств вырезались из чистого и легированных кристаллов TGS в форме пластинок толщиной 0.2 mm и линейными размерами в плоскости, перпендикулярной полярной оси, 3-10 mm. Проводящие электроды наносились из суспензии на основе мелкодисперсного серебра. Измерения температурных зависимостей диэлектрических потерь tg  $\delta$  проводились в вакууме  $10^{-5}$  bar в процессе охлаждения

образцов от 340 К после их предварительного прогрева при этой температуре в течение 1 h. Измерения проводились с использованием измерителя иммитанса E7-20 в диапазоне частот  $10^2 - 10^6$  Hz при напряженности электрического поля 2.5 V/cm. Петли диэлектрического гистерезиса измерялись при использовании обычной схемы Сойера–Тауэра на частоте 50 Hz.

# 3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Как известно, при выращивании из водных растворов чистых [1] и легированных примесью  $H_3PO_4$  [6] кристаллов TGS их размеры, габитус и электрические свойства зависят от многих факторов (таких как концентрация, соотношение компонент и величина pH исходного раствора, начальная температура роста и скорость ее изменения, наличие или отсутствие затравки и др.). При таком способе выращивания кристаллы характеризуются (особенно в случае малорастворимых примесей, таких как  $H_3PO_4$ ) значительной неоднородностью распределения примесей (и соответственно электрических свойств) в различных областях кристаллов. Это обстоятельство было причиной заметного (около 20%) разброса значений коэрцитивного поля и поляризации насыщения.



**Рис. 1.** Петли диэлектрического гистерезиса кристаллов TGS. *а* — номинально чистые кристаллы, *b*, *c* — с примесями H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> и H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> соответственно.



**Рис. 2.** Температурные зависимости  $\lg \delta$  кристаллов TGS. a-c — то же, что на рис. 1.

В то же время изменение концентрации примесей в исходных растворах в диапазоне значений х от 0.1 до 0.5 не приводило к качественному изменению характера наблюдаемых изменений свойств кристаллов; по этой причине на рис. 1-4 приведены данные, полученные на легированных кристаллах TGS при x = 0.5. В согласии с результатами [6-8] в кристаллах, легированных Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub>, наблюдалось увеличение коэрцитивного поля без сколько-нибудь существенного уменьшения поляризации насыщения (рис. 1, a, b). В кристаллах TGS, легированных Н<sub>3</sub>РО<sub>3</sub>, кроме заметного уменьшения поляризации насыщения наблюдалась несколько необычная форма петли диэлектрического гистерезиса (рис. 1, c), которая может быть связана с наличием в кристаллах областей с непереключаемой поляризацией, как предположили авторы [15].

Выполненные нами измерения температурно-частотных зависимостей  $\varepsilon'$  и tg  $\delta$  для номинально чистых кристаллов TGS показали качественное согласие с данными, приведенными в работах [16–19], при заметном





**Рис. 3.** Температурные зависимости  $\varepsilon''$  кристаллов TGS. a-c — то же, что на рис. 1.

отличии от них температурно-частотных зависимостей tg  $\delta$  легированных кристаллов (рис. 2). Характерной особенностью последних является сильное (более чем на порядок) уменьшение величины tg  $\delta$  на частоте 10<sup>6</sup> Hz в области  $T < T_C$ , а также систематическое смещение к более высоким температурам максимумов этих зависимостей при увеличении частоты измерительного напряжения. Это указывает на наличие в исследуемых кристаллах быстрых релаксационных процессов, которые, как и в чистых кристаллах, предположительно связаны с осцилляцией доменных стенок вблизи дефектов [16,18]. При этом с учетом близости рассматриваемой релаксации к дебаевской [18] для количественной оценки ее параметров (времени релаксации  $\tau$ , энергии активации U и предэкспоненциального множителя  $\tau_0$ 

в выражении  $\tau = \tau_0 \exp(U/kT)$ ) исследовались температурные зависимости мнимой части  $\varepsilon'' = \varepsilon' \operatorname{tg} \delta$  комплексной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon^* = \varepsilon' - i\varepsilon''$  (рис. 3), описываемые, как известно, выражением

$$\varepsilon'' = (\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)\omega\tau/(1 + \omega^2\tau^2), \qquad (2)$$

где  $\varepsilon_s$  и  $\varepsilon_{\infty}$  — низкочастотная и высокочастотная (для данного релаксационного процесса) диэлектрические проницаемости соответственно,  $\omega = 2\pi f$ , f — частота измерительного напряжения.

Как видно из рис. 3, релаксационные максимумы  $\varepsilon''(T)$ чистых и легированных кристаллов проявляются не столь отчетливо, как соответствующие максимумы зависимостей tg  $\delta(T)$ , и смещены относительно последних в область более высоких температур. Причиной указанного различия является относительно большое изменение величины  $\varepsilon_s$  (по сравнению с  $\varepsilon_\infty$ ) в исследованном интервале температур, что может привести к значительной погрешности в определении параметров релаксации из температурных зависимостей tg  $\delta$ . Это определяет необходимость построения зависимостей  $\varepsilon''(T)$  для корректного определения параметров релаксации. На рис. 4 представлены рассчитанные по данным рис. 3 температурные зависимости времен релаксации  $\tau = 1/2\pi f_m$ , где f<sub>m</sub> — частота, соответствующая температуре T<sub>m</sub> максимума величины є". Найденные из этих зависимостей значения энергии активации составили  $0.15 \pm 0.05 \, \text{eV}$ в случае чистых кристаллов,  $0.80 \pm 0.05 \,\text{eV}$  в случае кристаллов, легированных  $H_3PO_4$ , и  $0.60 \pm 0.05 \,\text{eV}$  в случае H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>; соответствующие им значения т<sub>0</sub> имеют величину порядка 10<sup>-10</sup> s в случае чистого TGS и необычно малую величину порядка 10<sup>-17</sup> s в случае TGS, легированного H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> и H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>. Отметим, что полученное нами значение энергии активации для чистых кристаллов согласуется с приведенным в работе [16] значением 0.12 eV.



**Рис. 4.** Температурные зависимости времени релаксации кристаллов TGS: номинально чистых (1), с примесью  $H_3PO_4$  (2), с примесью  $H_3PO_3$  (3).

Увеличение энергии активации U для движения доменных стенок в кристаллах с примесью H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> по сравнению с примесью H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> может быть связано с отмеченным выше различием дипольных моментов молекул в этих соединениях [20]. Следует учитывать также и специфику систем водородных связей, образуемых тетраэдрами (PO<sub>4</sub>)<sup>3–</sup> и (HPO<sub>4</sub>)<sup>2–</sup> с молекулами глицина и между собой в составе соответствующих соединений и определяющих наличие сегнетоэлектрических свойств в кристаллах глицинфосфита и отсутствие таковых в кристаллах глицинфосфита [12,13].

Таким образом, обнаруженная в работе диэлектрическая релаксация и найденные значения ее параметров в кристаллах TGS, легированных примесями  $H_3PO_4$ и  $H_3PO_3$ , указывают на существенное увеличение в исследованном интервале температур (по сравнению с номинально чистыми кристаллами) энергии взаимодействия (и соответственно времен релаксации) доменных стенок с дефектами структуры кристаллов, вызванными присутствием этих примесей.

## Список литературы

- [1] R.B. Lal, A.K. Batra. Ferroelectrics 142, 51 (1993).
- [2] C.S. Fang, Y. Xi, A.S. Bhalla, L.E. Cross. Ferroelectrics 51, 9 (1983).
- [3] A.S. Bhalla, C.S. Fang, L.E. Cross, Y. Xi. Ferroelectrics 54, 151 (1984).
- [4] Y. Kim, G. Park. Ferroelectrics 146, 99 (1993).
- [5] G. Ravi, S. Anbukumar, P. Ramasamy. J. Cryst. Growth 133, 212 (1993).
- [6] N. Nakatani, M. Yoshio. Jap. J. Appl. Phys. 35, 5752 (1996).
- [7] N. Nakatani, M. Yoshio. Jap. J. Appl. Phys. 35, L 508 (1996).
- [8] N. Nakatani, M. Yoshio. Jap. J. Appl. Phys. 36, L 245 (1997).
- [9] www.colby.edu/chemistry/webmo.
- [10] International table for X-ray crystallography / Eds N.F.M. Henry, K. Lonsdale. The Knoch Press, Birmigham (1969). V. 3. Ch. 4.
- [11] S. Dacko, Z. Czapla, J. Baran, M. Drozd. Phys. Lett. A 223, 217 (1996).
- [12] M.-T. Averbuch-Pouchot, A. Durif, J.C. Guitel. Acta Cryst. C 44, 99 (1988).
- [13] M.-T. Averbuch-Pouchot. Acta Cryst. C 49, 815 (1993).
- [14] В.В. Леманов, С.Н. Попов, Г.А. Панкова. ФТТ **44**, 1123 (2002).
- [15] W. Windsch, R. Kunze, G. Volker. Phys. Stat. Sol. (a) 26, K 175 (1974).
- [16] В.М. Петров, О.И. Коган. Кристаллография **15**, 1018 (1970).
- [17] А.С. Сонин, С.С. Горбач. Изв. АН ССС. Сер. физ. 29, 1996 (1965).
- [18] J. Fousek, V. Janousek. Phys. Stat. Sol. 13, 195 (1966).
- [19] K. Itoh, T. Mitsui. J. Phys. Soc. Jap. 23, 334 (1967).
- [20] G. Arlt, H. Neumann. Ferroelectrics 87, 109 (1988).